層状 SnO へのアンモニアインターカレートとその評価

Ammonia intercalation into layered SnO thin films and their characterization

辛 佳和 (電気電子工学科)

Yoshikazu Shin

高機能デバイス研究室 指導教員 相川 慎也 准教授

1. 緒言

SnO_x系材料は両極性を示すことから, Snの酸化状態を制御す ることで同一材料での pn 接合を用いた CMOS や透明太陽光電 池を実現できる材料として注目されている.p型伝導を示す SnO の価電子帯端(VBM)は Sn 5s 軌道で構成され,バンド分散が大 きく,有効質量が軽い.そのため,高い正孔移動度を持つ p型酸 化物が期待できる[1].しかし, SnO はバンドギャップが約 0.7 eV と小さく,薄膜の透明性と移動度がトレードオフの関係にあるた め,透明デバイスとしての応用が現状難しい[2].

この問題に対し, Hu らは, 層状構造を有する SnO の層間に CH4, NH3, CH3OH をインターカレートすることで, 層間距離が増 加し, バンドギャップと電気特性が向上する理論計算を報告して いる[2]. これらの3種類の分子において, CH4は標準状態で気体 であるため扱いが困難であり, CH3OH は分子量が他の二つと比 較して大きいため, インターカレートが難しいと考えられる.

そこで本研究では、CH₃OH より分子量が小さく、扱いが比較 的容易な NH₃を用いて、SnO の層間へのインターカレートを実験 的に行い、層間隔の拡大に伴うバンドギャップの拡張と電気特性 の向上を目指した。

2. 実験方法

SnO をスパッタリングにて成膜後,ホットプレートを用い,大気中 250 ℃,45 分アニールを行った.さらに,密閉容器内に SnO 薄膜および 25%アンモニア水を 1 ml を封入し,加圧アニールを400 ℃,60 分行った.

結晶構造と結晶方位は X 線回折装置(XRD)を用いて評価した.また,局所的な分子構造と層間距離は Raman 分光装置を用い,薄膜の電気特性はホール測定より評価を行った.

3. 実験結果および考察

Fig. 1 に大気アニールのみ、および大気アニール後に加圧アニ ールを施した SnOx 膜の XRD パターンを示す. 2つの試料にお いて Sn と SnO の結晶構造が存在していることがわかる.また、ア ンモニア水での加圧アニール処理前後においてスペクトルのピー ク数および位置が変化していないことから、Sn と SnO の結晶が 加圧アニールによってダメージを受けていないと言える.

Fig. 2 にそれぞれの SnOx 膜の Raman スペクトルを示す.112 cm⁻¹(a), および 216 cm⁻¹(b)で確認されたピークは SnO に起因 するものであり, それぞれの振動モードは Blg および Alg mode で ある. このことから, 2つの薄膜とも SnO の存在が確認された.加 圧アニール後の Alg, Blg ピークは, ともに高波数側にシフトした. これはアンモニア分子が層間にインターカレートされたことにより 層間隔が拡大し, Sn-Sn のローンペアに作用するクーロン斥力が 弱まることで, 酸素原子間の距離が縮まったためだと考えられる. つまり, Sn と O で構成される層が押しつぶされた結果, 層間隔が 拡大したと考えられる.

Table 1 にそれぞれの SnOx 膜の Hall 測定の結果を示す. 加圧 アニールを行った膜は正孔移動度が約 6 倍増加していることが 確認された. これは, 加圧アニール処理により面内の O 2p/Sn 5s における軌道重なり強度が高まったことでバンド幅が大きくなり, 正孔の有効質量が減少したためだと考えられる.







Wavenumbers [cm⁻¹]

Fig. 2 大気アニールのみ, および大気+加圧アニールを施した SnO_x 膜の Raman シフト: (a) B_{1g} mode (b) A_{1g} mode.

族的电影时任			
アニール	Hall mobility (cm²/Vs)	Carrier density (cm ⁻³)	Conduction type
大気	0.17	9.9 × 10 ¹⁸	р
大気+加熱	1.1	2.7 × 10 ¹⁸	р

4. 結論

本研究では、SnO 層間へのアンモニアインターカレートにより、 バンドギャップの拡張と電気特性の向上を目指した。アンモニア 水を封入した加圧アニール処理を施すことで、SnO の層間にアン モニア分子が層間にインターカレートされたことが Raman 分校の 結果より示唆された.また、Hall測定よりインターカレートに基づく 電気特性の向上が確認された。

5. 参考文献

[1] R. Barros, et al., Nanomaterials 9, 320 (2019).

[2] Y. Hu et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 25671-25677 (2022).